

聚四氟乙烯晶圆清洗篮 4英寸蚀刻架 耐酸碱 定制掩膜载具

货号: PL-CP90



简介

专为半导体晶圆清洗与化工处理设计的精密加工聚四氟乙烯蚀刻篮。这些耐酸高纯清洗架可在要求严苛的实验室环境中实现零污染。可根据工业掩膜与晶圆的特殊尺寸完全定制，适用于先进制造与研发应用。

了解更多

应用场景	说明	核心优势
半导体湿法蚀刻	将硅晶圆浸入酸性溶液去除薄膜或清洁表面。	完全耐受氢氟酸和其他强蚀刻剂，零材料降解。
光掩膜清洗	承载敏感石英掩膜完成特殊化学清洗与漂洗循环。	低硬度材料接触，避免复杂掩膜图案表面受损。
太阳能电池制造	在制绒和掺杂清洗工序中处理光伏晶圆。	高承载量与化学稳定性，提升整体制造效率。
MEMS加工	在各类化学蚀刻环境中处理机电系统部件。	精准开槽设计，确保搅拌过程中牢固固定小型易碎部件。
痕量金属分析	在分析测试前对实验器皿和容器在高纯酸浴中清洗。	提供无金属清洗环境，消除交叉污染。
纳米技术研究	在新型化学溶液与反应环境中处理实验基材。	广泛适配温度与化学环境，支持各类研究方案。

特性	PL-CP90规格详情
型号	PL-CP90
材料	高纯聚四氟乙烯 (Polytetrafluoroethylene)
兼容晶圆尺寸	4英寸 (标准款) / 尺寸可完全定制
卡槽配置	卡槽数量与间距均可定制
耐化学性	通用耐酸、碱、溶剂性能
工作温度范围	-200°C 至 +260°C
表面处理	CNC精密加工 / 极低表面粗糙度
手柄设计	可拆卸或固定款式可选 (支持定制)
排水设计	高流通开口框架结构
制造方式	全流程定制CNC加工
订单类型	根据客户规格定制产品